# 光フィルタ型変位計測による MEMS 加速度センサ

## MEMS accelerometer using multi-layer optical filter with air gap resonator

○ 溝延大和\*、豊田宏\*、小野俊郎\*

○ Hirokazu Mizonobe\*, Hiroshi Toyota\*, and Toshiro Ono\*

## \*弘大院理工

#### \*Hirosaki Univ.

 キーワード: ECR(Electron Cyclotron Resonance),加速度センサ(Accelerometer),微小電気機械システム(Micro Electro Mechanical Systems), Fabry-Perot 狭帯域光フィルタ(Fabry-Perot type narrow band pass filter)
連絡先:〒036-8561 青森県弘前市文京町3番地 弘前大学大学院理工学研究科 小野俊郎, Tel:(0172)39-3948, Fax: (0172)39-3948, E-Mail: tono@cc.hirosaki-u.ac.jp

# 1. 序論

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)加速 度センサは自動車産業からゲームマシン、医療分 野に至る様々な場でその応用が期待されており、 高感度、広範囲な計測領域を確保した高性能デ バイスの要求が高まっている。そこで、光学多層膜 狭帯域バンドフィルタの原理を用いて、光のスペク トル波長の変化から加速度を検出する光共振器型 MEMS加速度センサを検討した<sup>(1)</sup>。透過型狭帯域 バンドフィルタのキャビティ層を空洞とし、加速度に よるキャビティ層厚みの変化を透過光波長で計測 し、加速度を求める。本報では、透過分光型 MEMS加速度センサの光学設計と、機械特性によ る構造評価、多層膜作製時の誤差が透過スペクト ルに与える影響の考察を行った。

# 狭帯域バンドフィルタ型 MEMS 加速度センサの構造

図 1 に透過型MEMS加速度センサの構造例を 示す。本構造は、狭帯域フィルタとして利用されて いるファブリペロー共振器<sup>(2)</sup>を応用している。ファブ リペロー共振器は、膜厚が λ<sub>0</sub>/4 光路長で積層した ミラー層と、λ<sub>0</sub>/2 光路長のキャビティ層によって構 成される。設計波長 λ<sub>0</sub>において急峻で狭帯域の 透過ピークを得ることができる。キャビティ層を空気 とし、多層膜を自立メンブレン構造とすることで加速 度によってメンブレンが変位し、キャビティ層厚み の変化を透過光波長の変化として検出できる。出 力光はPLC(Planar Lightwave Circuit)<sup>(3)</sup>などの分光



回路によって個々の波長に対応したPDセル、CCD セルに導かれる。フィルタ光が十分狭帯域で、その 波長変化が加速度に対して線型であれば、受光セ ルを認識することで演算なしに加速度を計測するこ とができる。

#### 3. 透過型多層膜フィルタの分光特性

キャビティ層を持つバンドフィルタの特性をシミュ レーションにより求めた。光源光は強度、帯域、受 光素子感度を考慮して中心波長を 550nmとした。 図2に透過型狭帯域バンドフィルタの特性を示す。 この構造は(入射側)Air/H/ミラー層(L,H)<sup>n</sup>/Air (cavity)275nm/ ミラー層(H,L)<sup>n</sup>/H/Air(射出側)であ る(H: λ<sub>0</sub>/4 高屈折率膜,L: λ<sub>0</sub>/4 低屈折率膜)。本構 造では、ミラー層数を多く、またミラー多層膜の屈 折率比が大きいほど狭帯域化に有利である。シミュ レーションでは高屈折率膜にTa2O5(n=2.15)、低屈 折率膜にSiO<sub>2</sub>(n=1.48)を用い、ミラーペア数を 14 ペアとした。図に示すように、FWHM=0.4nmとSN 比の高い狭帯域スペクトルが容易に得られる。また、 図3にキャビティ層変位と透過の狭帯域スペクトル 波長の関係を示す。キャビティ層変位に対応して、 急峻なスペクトルのピークが短波長側へと移動して いる様子が分かる。計算結果から、キャビティ層変 位とスペクトル波長んが線型関係をもつ範囲は、設 49.4nmとなった。





図 2.透過型挟帯域バンドフィル タの特性

図 3.キャビ、ティ層厚さとスペクトル 光の関係

#### 4. 機械特性の評価

加速度によるキャビティ層厚みの変化を検討した。 人体行動センシングを目的に、最大加速度 50gに 対するキャビティ層変位が線型スペクトル波長範囲 と合致するように構造を決定する。2 対の自立ミラ 一層の一方にスペクトルを検出する微小孔を有す る錘層を設けることで、変位を調整する。自立多層 膜(H,L)層は計算上は同じ厚さのSi層として扱った。 錘と自立膜に加速度が作用するとき、変位は等分 布荷重の薄膜の撓み式で求めることができる<sup>(4)</sup>。

$$\omega = 0.014 \cdot \frac{\rho \cdot (\kappa \cdot g) \cdot a^4}{E \cdot h^2} \cdots (1)$$
$$\omega = 1.01 \cdot a \cdot \sqrt[3]{\frac{\rho \cdot (\kappa \cdot g) \cdot a}{E}} \cdots (2)$$

ここでω:撓み量、a:メンブレン寸法、E:ヤング率 (Si:160Gpa)、h:メンブレンの膜厚(1.16 μ m)、ρ:メ ンブレンの密度(Si=2330kg/m<sup>3</sup>)、g:重力加速度、 κ:定数である。(1)式は小撓みの式、(2)式は大撓 みの式である。(1)式、(2)式を連立させて撓みを求 めると撓みの交点はメンブレン寸法によらず等しい 値となる。この交点の撓みを小撓みと大撓みの境 界の撓みω₀とする。境界の撓みと膜厚hの比ω₀/h を求めると、ω₀/h=1.48 という定数が得られる。この 定数と実際のメンブレンのω/hの大小関係から、撓 み式を選定する。メンブレン寸法a=2.0mmのとき、 加速度 50gでメンブレンの撓み差Дω=60nmとなる



錘の厚みは計算から 31nmとなる。この条件での最 大撓みとメンブレンの膜厚の比ω<sub>MAX</sub>/h=0.97 は、 境界の撓みの定数ω<sub>0</sub>/h=1.48 より小さいため撓み ωと加速度の関係は小撓みの式に従う。ことからメ ンブレンの撓みと加速度の関係は線型性を持つこ とがわかる。

## 5. 膜厚誤差が透過スペクトルに与える影響

成膜プロセスでは、ECR(Electron Cyclotron Resonance:ECR)スパッタ法を用いる。λ/4 光路長 が設計値に対し誤差がある場合の透過スペクトル に与える影響を検討した。図4に膜厚誤差と波長の ずれの関係を示す。計算結果から膜厚誤差に比 例して波長のずれは大きくなる。通常想定される膜 厚誤差 5%以上では波長のずれが大きいが、膜厚 誤差0.5%程度とすれば⊿ん=0.3nmとなり、許容範 囲となることが推定される。図 5 に屈折率誤差と波 長のずれの関係を示す。この場合も同様に屈折率 誤差に比例して波長のずれが大きくなる。ECR ス パッタにおける屈折率の再現性は、誤差範囲 0.1% 以下で可能である。計算結果では屈折率誤差 0.1%で⊿λ=0.11nm となっている。多層膜形成に ECR スパッタを用いる場合には、屈折率誤差が透 過スペクトル波長に与える影響は非常に小さいこと が分かった。

## 6. 結言

ファブリペロー型の共振器を応用した新規の構造 のMEMS加速度センサを検討した。共振器を空洞 (Air)とすることで、加速度に対し線型な関係で透 過スペクトルを計測できる。機械的評価では、膜厚 hと最大変位 ω MAXの関係から撓みの状態につい て検討し、加速度とメンブレンの撓みが線型な関係 を持つための条件を明らかにした。これによりスペ クトル波長、キャビティ層厚み、加速度が互いに線 型性を持つことが分かった。また、誤差が透過スペ クトルに与える影響を検討した結果、膜厚誤差に 関しては 0.5%以下、屈折率誤差に関しては 0.1% 以下の範囲で制御することにより、デバイスの較正 が不要で、高度な演算回路を必要としないシンプ ルで高性能なMEMS加速度センサ構造化の可能 性を見出した。

#### 参考文献

(1)溝延大和,分光型 MEMS 加速度センサの構造 化,第68回応用物理学会学術講演会,北海道工 業大学,平成19年9月7日

(2)吉田貞史 矢嶋弘義,薄膜・光デバイス,東京大 学出版会

(3)作花済夫, ガラス科学の基礎と応用, 内田老鶴 圃

(4)S・P・チモシェンコ,板とシェルの理論,ブレイン図 書出版株式会社